有機薄膜太陽電池の電荷分離機構におけるエントロピーの影響 (¹東大院・工, ²CREST, JST) ○川嶋英佑,^{1,2} 藤井幹也,^{1,2} 山下晃一^{1,2}

Entropic Effect on Charge Separation of Organic Photovoltaics (¹Univ. Tokyo, ²CREST, JST) OEisuke Kawashima,^{1, 2} Mikiya Fujii,^{1, 2} Koichi Yamashita^{1, 2}

1 研究背景

有機薄膜太陽電池 (organic photovoltaics, OPV) は有機半導体から構成される太陽電池で, 新たな エネルギー変換デバイスとして注目されている. しかしながら OPV の変換効率は最高でも 11 % 程度^[1] と既存のシリコン系太陽電池 (20 %) よ り低く,課題となっている.

1.1 モルフォロジー

OPV の微細構造—相分離,ドメインの大きさ, 結晶性—をモルフォロジー (morphology) とい う.中でも bulk heterojunction (BHJ)^[2]は 10 nm 程度で相分離しており,理想的なモルフォロジー とされている.モルフォロジーは励起子の解離 及び電荷の再結合に影響し変換効率を変化させ ると考えられているが,その効果についての知 見は十分でない.

1.2 電荷分離過程

電荷分離は光電変換において重要な過程の一 つである. OPV の変換効率が低い原因の一つ として, 無機系材料に比べ低い誘電率により, Coulomb 力が強く電荷が十分に分離できないこ とが考えられている.

電荷分離は古典的には Onsager–Braun 機構^[3] で記述されてきたが,熱緩和するか否か (cool vs hot) について議論が続いている.^[4] 自由エネル ギーにより電荷分離が促進されることを示唆す る報告がある^[5,6] ものの,それらはモルフォロ ジーを陽に考慮しておらず,より詳細な解析が 必要である.

2 研究目的

Helmholtz エネルギーが OPV の電荷分離過程 に及ぼす影響を明らかにし,その物理的描像に ついて知見を深める.最適なモルフォロジーを 提案する.

3 手法

3.0 モルフォロジー

ドナー高分子とアクセプター低分子からなる BHJ モルフォロジーを生成した. Reptation^[7,8]を 用いて生成した熱アニール下におけるモルフォ ロジーの一部を Fig. 1 に示す. β は逆温度, $\Delta\epsilon$ は構成分子の相対的な相互作用で, 負であれば 高分子は凝集する. したがって, $\beta\Delta\epsilon$ が大きい ほどアニーリング温度が高い. 格子定数は 1 nm, シミュレーション体積はは 150 nm 立方で, 体積



Fig. 1: 初期構造とアニールした BHJ モルフォロジー. 白は電子供与体, 黒は電子受容体を表す.

分率は 1:1 である. 低温だと十分に構造緩和出 来ず,高温だと自由拡散で高分子が遊離するた め,界面面積は $\beta\Delta\epsilon = -1$ で最小である.

3.1 Helmholtz エネルギーとエントロピー

3.0 で生成したモルフォロジーにグラフ理論^[9] を適用し,エントロピー*S*および Helmholtzエ ネルギー*F*を以下の式より計算した:

Coulomb 力
$$E(\mathbf{r}_{\rm h}, \mathbf{r}_{\rm e}) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{\rm r}|\mathbf{r}_{\rm h} - \mathbf{r}_{\rm e}|},$$

状態密度 $\Omega(\epsilon, R) = \iint \mathrm{d}\mathbf{r}_{\rm h}\mathrm{d}\mathbf{r}_{\rm e}$
 $\delta(\epsilon - E)\delta(R - |\mathbf{r}_{\rm h} - \mathbf{r}_{\rm e}|),$
分配関数 $Z(R) = \int \mathrm{d}\epsilon \ \mathrm{e}^{-\beta\epsilon}\Omega(\epsilon, R),$
内部エネルギー $U(R) = \frac{1}{Z}\int \mathrm{d}\epsilon \ \epsilon \ \mathrm{e}^{-\beta\epsilon}\Omega(\epsilon, R),$
Helmholtz エネルギー $F(R) = -\frac{1}{\beta}\ln Z(R),$
 $\mathrm{L} \sim \mathrm{h}\,\mathrm{L}^2 - S(R) = \frac{U(R) - F(R)}{T}.$

モルフォロジーの各サイトをノードで表現し, 幅優先探索によりある界面から到達可能なド ナー-アクセプターサイトの組を全て見つけ,各 組について Euclid 距離から *E*を計算し,*F* およ び*S*を求めた.



Fig. 2: (a) 電荷分離における内部エネルギー U(R), Helmholtz エネルギーF(R), エントロピー 項 -TS(R). モルフォロジーは $\beta\Delta\epsilon = -2$ のも の. (b) Helmholtz エネルギー障壁.

3.2 電荷分離ダイナミクス

Helmholtz エネルギーが電荷分離に及ぼす影響を Dynamic Monte Carlo 法^[8,10] で検証した. 素過程として電荷の(i)移動,(ii)捕集,(iii)再結合を確率モデル化し,速度は(i)および(ii)では Marcus 式より求め,(iii)では定数として与えた.温度を 300 K に設定し,励起子解離直後の状態として界面を挟むドナー・アクセプター に正孔・電子を1組生成し,それらが分離する(空間的・時間的に十分離れるか電極に捕集されるか)か再結合するかをシミュレートした.これを全界面について行うことで,電荷分離状態における Helmholtz エネルギー曲線上の正孔・電子の運動を推算した.

4 結果と考察

4.1 Helmholtz エネルギーとエントロピー

計算した Helmholtz エネルギー F を Fig. 2 (a) に示す.エントロピーの寄与により, Helmholtz エネルギーが大幅に低下し, R = 6 nm 程度を境 に減少することが明らかになった.励起子が解 離した直後の状態 (R = 1 nm) から電荷分離に必 要なエネルギー障壁を max F(R) - F(1 nm) と定 義し, Fig. 2 (b) に示す.エネルギー障壁はモル フォロジーに依存し,室温の 10 倍程度であるこ とが明らかとなった.

4.2 電荷分離ダイナミクス

各モルフォロジーについて,再結合率と界面 面積をFig.3に示す.再結合率はモルフォロジー に依存し,界面面積と相関があることが明らか になった.これは,界面面積が小さいほどドメ インが大きく,電荷が分離していく輸送経路が 多いためである.また,この結果はHelmholtzエ ネルギー障壁 (Fig.2 (b))と整合する.

再結合した正孔・電子間の最大距離を解析す ると,最頻値 (> 99%) は 1 nm で,最大値は 3 nm であった. max *F*(*R*) – *F*(3 nm) は室温 26 meV の 1.1–1.6 倍であった.すなわち,正孔・電子は



Fig. 3: 各モルフォロジーの再結合率ならびに界面面積.

3 nm 以上離れると熱揺動で Coulomb 引力に打ち勝ち,エネルギー障壁を越えて分離できるということが明らかになった.

界面構造についての考察は当日報告する.

5 結論

モルフォロジーを陽に扱うことで、電荷分離 過程において、(i) エントロピーSの寄与により Helmholtz エネルギーFが大幅に減少し、(ii) F が正孔-電子距離 6 nm 程度で極大をとる、とい う新たな描像を示した.

Dynamic Monte Carlo のシミュレーションに より,電荷分離と Helmholtz エネルギー障壁と の相関が得られ,上記描像が支持された.特に, 正孔と電子が 3 nm 以上離れられれば室温でエ ネルギー障壁を越え,再結合せずに分離するこ とが明らかになった.

References

- Green, M. A. *et al. Prog. Photovolt: Res. Appl.* 24, 905–913 (2016).
- 2. Yu, G. et al. Science 270, 1789–1791 (1995).
- Braun, C. L. J. Chem. Phys. 80, 4157–4161 (1984).
- Bassler, H. & Kohler, A. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 28451–28462 (2015).
- Ohkita, H. et al. J. Am. Chem. Soc. 130, 3030– 3042 (2008).
- Giazitzidis, P. et al. Org. Electron. 15, 1043– 1049 (2014).
- Frost, J. M. et al. Nano Lett. 6, 1674–1681 (2006).
- 8. Kawashima, E., Fujii, M. & Yamashita, K. *Phys. Chem. Chem. Phys.* (submitted).
- 9. Wodo, O. *et al. Org. Electron.* **13**, 1105–1113 (2012).
- 10. Meng, L. et al. J. Chem. Phys. 134, 124102 (2011).